



⑬ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 102 06 984 A 1**

⑤① Int. Cl. 7:
H 01 L 21/3205
H 01 L 21/316
H 01 L 21/205
H 01 L 21/66

⑳ Aktenzeichen: 102 06 984.0
㉔ Anmeldetag: 20. 2. 2002
㉕ Offenlegungstag: 10. 4. 2003

DE 102 06 984 A 1

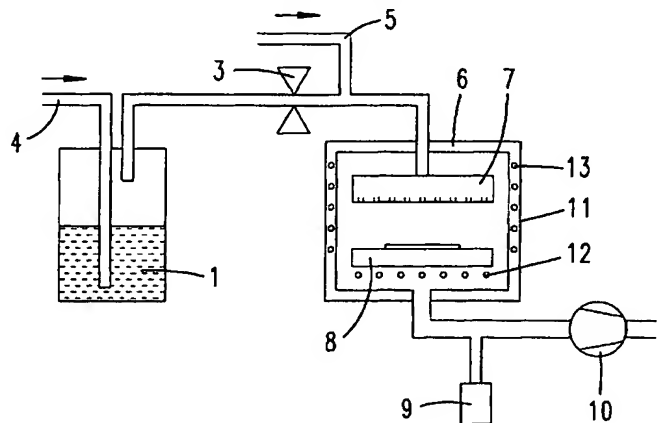
⑥⑥ Innere Priorität:
101 50 776. 3 08. 10. 2001
⑦① Anmelder:
AIXTRON AG, 52072 Aachen, DE
⑦④ Vertreter:
H.-J. Rieder und Partner, 42329 Wuppertal

⑦② Erfinder:
Schumacher, Marcus, Dr., 50171 Kerpen, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

⑤④ Verfahren und Vorrichtung zum Abscheiden einer Vielzahl von Schichten auf einem Substrat

⑤⑦ Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abscheiden einer Vielzahl von Schichten auf einem Substrat mittels gasförmiger Ausgangsstoffe, wobei die Schichten in einer einzigen Prozesskammer in aufeinander abfolgenden Prozessschritten abgeschieden werden. Die Gasphasen-Zusammensetzung und/oder die Substrattemperatur wird ohne zwischenzeitiges Öffnen der Prozesskammer variiert, so dass Schichten verschiedenartiger Qualität in einer Depositionskammer nacheinander abgeschieden werden kann.



DE 102 06 984 A 1